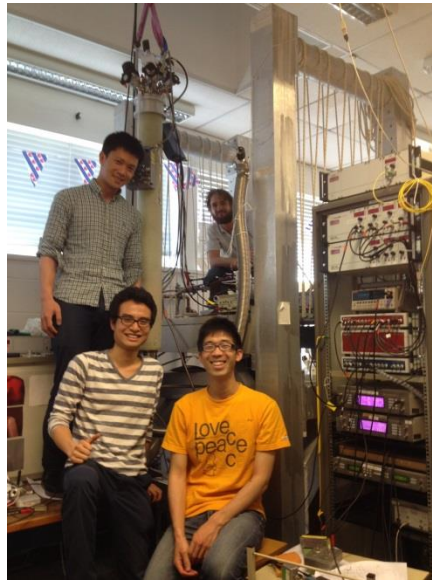


Cavendish 研究所での共同研究を終えて

物理工学専攻 D2 森川 生(町田研)

2015/4/6-7/7 の約三か月間、英国 Cambridge 大学 Cavendish 研究所に共同研究のために滞在した。日本で作製したグラフェンデバイスを、M. R. Connolly 博士のグループが有する **Scanning Gate Microscopy** という技術で測定した。当初は、勝手の良く分からない測定系ということもあり、果たして自分の作製したデバイスがきちんと動作するのかとても心配であったが、出発前も含めた先方の親身なサポートのお蔭で、三か月間で期待以上に多くの実験にトライすることができ、大変充実した滞在となった。また、語学の壁は確かに高いながらも、明確に自分の意見やヴィジョンを持ちながら、他人とコミュニケーションを取り、真面目に **Hard Work** するという点は、世界のどこにいても大事なことであるなど改めて痛感できた。温かく私を受け入れてくれた Connolly 研の皆様、特に、親身にご指導いただいた M. R. Connolly 博士、三か月間つきっきりで一緒に実験をしてくれた Z. Dou 氏、そして快く送り出してくれた町田先生はじめ町田研の皆様は心より感謝したい。また、このような貴重な場を実現してくださった ALPS コースの多大なるご支援に御礼申し上げる。



SGM 測定系前にて

(左上から時計回りに Z. Dou 氏, M. R. Connolly 博士, S. Wang 氏, 森川)